EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002139600

PUBLICATION DATE

17-05-02

APPLICATION DATE

02-11-00

APPLICATION NUMBER

2000335351

APPLICANT:

ONO KATSUHIRO;

INVENTOR :

ONO KATSUHIRO;

INT.CL.

G21K 5/00 A61L 2/08 G21K 1/04

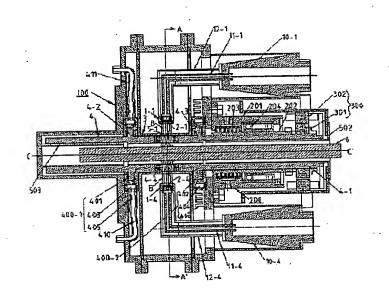
G21K 5/04

TITLE

ROTATING WINDOW TYPE

ELECTRON BEAM IRRADIATION

EQUIPMENT



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide electron beam irradiation equipment capable of emitting an electron beam of a high density toward a body to be irradiated from the whole circumference of the body without rotating the body in a irradiation with electron beam for hardening, reforming, or cross-linking of a resin applied to the surface of an object having a three-dimensional shape, or sterilization of a medical tool.

SOLUTION: In this equipment, a structure including an electron transmission window for taking the electron emitted from a cathode provided within a vacuum area kept in a high vacuum state out of the vacuum area while accelerating it with an anode having an electron passing hole, is formed in a cylindrical shape. A first thick part and a second thin part are alternately provided on the circumference of the structure including the electron transmission window, and the second part has the function of transmitting the electron beam while constituting a vacuum barrier wall, and the first part has the function of cooling the first part while keeping the mechanical strength. The rise of temperature in the second part is minimized by rotating the electron transmission window at a high speed, so that the electron beam of high density can be transmitted in a short time.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

WANTE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-139600 (P2002-139600A)

(43)公開日 平成14年5月17日(2002.5.17)

(74) 7 . (7) 7		識別記号		FΙ			. Ť	7]ド(参考)
(51) Int.Cl. ⁷	E /00			C 2 1 K	5/00		w	4 C 0 5 8
G 2 1 K	5/00	•					· · C	
	•				•		. D	
A 6 1 L G 2 1 K	2/08			A 6 1 L	2/08			·
				C 2 1 K			S	ه معمد حمد ده م
0 2 2 12	•		審査請求	未請求 請才	を項の数14	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
								•

(21)出顯番号

特願2000-335351(P2000-335351)

(22) 出顧日

平成12年11月2日(2000.11.2)

(71)出願人 399116102

小野 勝弘

栃木県宇都宮市戸祭台29-3

(72)発明者 小野 勝弘

栃木県宇都宮市戸祭台29一3

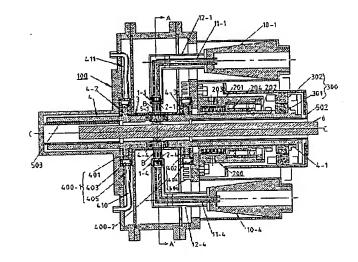
Fターム(参考) 4CO58 AA16 BB06 KK03 KK14 KK26

(54) 【発明の名称】 回転ウインドウ型電子線照射装置

(57)【要約】

【課題】解決しようとする課題は、立体形状を有する物体の表面に塗布した樹脂の硬化、改質、架橋等や、医療用具の滅菌等を行うために電子線を照射する場合に、被照射体を回転することなく被照射体の全周囲から被照射体に向かって高密度の電子線を照射することができる電子線照射装置を提供することである。

【解決手段】本発明では、高真空状態に維持された真空 領域内に設けられた陰極から放出された電子を、電子通 過孔を有する陽極との間で加速して、前記の真空領域の 外部に取り出す為の電子透過窓を含む構造体を円筒状に 形成し、この電子透過窓を含む構造体には周方向に肉厚 が大きい第1の部分と肉厚が小さい第2の部分を交互に 設け、この第2の部分は真空隔壁を構成しながら電子線 を透過させる働きをし、前記の第1の部分は機械的強度 を保ちながら前記の第1の部分を冷却する働きをもって おり、前記の電子透過窓を高速度で回転させることによ って、前記の第2の部分の温度上昇を小さくし、短時間 に高密度の電子線を透過させることができるようにして いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空領域を構成する真空容器と、この真空領域内に在って電子を放出する陰極と、この陰極から放出された電子を透過させて前記の真空領域の外部に取り出す為の電子透過窓を含む構造体と、この電子透過窓を含む構造体を回転させる回転機構と、前記の電子透過窓を含む構造体と前記の真空容器との境界部分を真空シールする回転シール機構とを有して成り、前記の電子透過窓を含む構造体は、動作時に回転するようになっていることを特徴とする回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項2】 前記の電子透過窓を含む構造体は、電子を透過させる薄い部分と熱を伝える厚い部分とが回転方向に沿って交互に配設された部分を有することを特徴とする特許請求項1 に記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項3】 前記の電子透過窓を含む構造体は、周方向に配列したスリットを有する円筒状の第1の構造体と、これに貼り付けられて電子透過膜を形成する薄膜と、周方向に配列したスリットを有する円筒状の第2の構造体とを有して成り、前記の第1の構造体と前記の第2の構造体との両方のスリットが共通する部分を有するように取り付けられて構成されていることを特徴とする特許請求項2に記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項4】 前記の電子透過窓は厚みが15μm以下のチタニューム箔から成っていることを特徴とする特許請求項2~3のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項5】 前記の電子透過窓を含む構造体の肉厚部分の表面は原子番号が小さな物質で出来ている部分を有することを特徴とする特許請求項2~4のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項6】 前記の電子透過窓は、これを含む構造体の回転中心軸に平行な方向に長いことを特徴とする特許請求項1~5のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項7】 前記の電子透過窓は、これを含む構造体の回転中心軸に並行な方向に対して周方向に45度以内の範囲で傾斜していることを特徴とする特許請求項1~6のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項8】 前記の陰極に対向した位置に電子通過孔を有する陽極が取り付けられており、この陽極の電子通過孔に対して前記の陰極と反対側に前記の電子透過窓を含む構造体が位置しており、前記の電子透過窓は前記の電子透過窓を含む構造体の内側表面の近傍に取り付けられていることを特徴とする特許請求項1~7のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項9】 前記の回転シール機構は磁性流体を有して構成されていることを特徴とする特許請求項1~8の

いずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項10】 前記の回転シール機構と前記の電子透過窓を含む構造体との伝熱通路の途中に、動作時に液体である金属を潤滑材とした動圧滑り軸受を取り付けたことを特徴とする特許請求項1~9のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項11】 前記の電子透過窓を含む構造体の最小の内径よりも小さな径を持つ領域に前記の被照射体を保持する様に構成された被照射体ガイドを設けたことを特徴とする特許請求項1~10のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項12】 前記の電子透過窓を含む構造体の回転方向に複数個の陰極が配列されていることを特徴とする特許請求項1~11のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【請求項13】 前記の陰極は前記の電子透過窓を含む 構造体の回転中心軸に平行な方向に対して周方向に傾斜 して取り付けられていることを特徴とする特許請求項1 ~12のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線 照射装置。

【請求項14】 前記の電子透過窓を含む構造体の回転と同期して前記の陰極が同軸状に回転することを特徴とする特許請求項1~13のいずれか1つに記載の回転ウインドウ型電子線照射装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、立体形状を有する 物体の表面に塗布した樹脂の硬化、改質、架橋等や、医 療用具の滅菌等を行うためにこれらの被照射体を回転す ることなく全周囲から電子線を照射する装置であって、 特に、照射する電子線の密度を増したことを特徴とする 電子線照射装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の電子線照射装置は、公開特許公 報、特開平11-19190号に記載されているよう に、固定されたドラム管状の真空容器の中に直線状の金 属フィラメントを取付け、これを通電加熱することによ って放出される熱電子を500KV以下の電圧で加速 し、薄い金属箔で出来た平板状の透過窓を透過させて、 大気中にある被照射体に電子線を照射するようになって いる。特開平11-19190号公開特許公報に記載の 装置の概略の横断面図を図1に示している。図1におい て、1001は真空容器であり、1003は電子銃構造 体であり、1002は電子銃構体1003等を支持する ターミナルであり、1004は陰極フィラメントであ り 1005はグリッドであり 1006は電子を透過さ せる電子透過窓である。陰極フィラメント1004から 放出された電子がグリッド1005に印加された電位差 で加速され、更に電子透過窓1006との間に印加され 4, 2

た500KV以下の電位差で加速されて電子透過窓10 06を透過する。透過した電子線 Bは照射室内にある被 照射体1011に照射される。この装置は大型であり、 電子線の照射方向が一定となっているのでシート状の被 照射体に電子線を照射する場合には適するが、立体形状 の物体に電子線を照射するのには適さない。このような 場合には、例えば、特開平11-19190号公開特許 公報に記載の装置では、図1に示すように、立体構造体 である被照射体1011は2本のワイヤ1009、10 10で回転させながら移動させられて前記の照射窓10 O6を透過してきた電子線Bが照射されるようになって いる。このように被照射体を回転させながら移動させた り、特開平10-268100号公開特許公報に記載の ように被照射体を傾斜面上で転がしたり、特開平10-268099号公開特許公報に記載のように被照射体を 裏返す機構を設けたり、特開平9-68600号公開特 許公報に記載のように被照射体の周囲に反射板を置いて 電子線を被写体の周囲に一様に照射する努力が払われて いる。上記の従来例はいずれの場合も装置が大型にな り、立体形状の被照射体に全周囲方向から照射するのが 難しいだけでなく、処理能率が悪いと言う問題があっ た。

【0003】特に、被照射体が小型の物体である場合や 線状の物体である場合には、上記の例では被照射体の周 囲に万遍無く電子線を照射するのは不可能に近い。又 照射される電子線の密度が大きく出来ないので、照射能 率が極めて悪いと言う問題がある。

【0004】これまでに全周囲方向から照射できる電子線照射装置が実現できなかった理由は以下のとおりである。先ず第1に、筒状の形状をしており真空領域から大気圧領域に電子を透過させるための電子透過窓が出来なかったことである。第2に、全周方向から均一な強度で且つ中心軸方向に均一に広がった分布をもつ電子線を発生させて高電圧で均一のエネルギーまで加速する方法が見出せなかったことによる。更に、第3の理由は、前記の電子透過窓は電子の透過率を大きくするために薄くする必要があるが、電子の透過の際の吸収による発熱で高温度まで過熱されて電子透過窓の信頼性が確保できなかったことである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】解決しようとする課題は、立体形状を有する物体の表面に塗布した樹脂の硬化、改質、架橋等や、医療用具の滅菌等を行うために電子線を照射する場合に、被照射体を回転することなく被照射体の周囲から被照射体に向かって高密度の電子線を照射することができる電子線照射装置を提供することである。特に、真空領域と大気領域との境界を形成しつつ電子線を透過させる電子透過窓の温度上昇を防ぐことによって高密度の電子線を短時間に信頼性良く照射することができる電子線照射装置を提供することを目的として

いる。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明では、高真空状態 に維持された真空領域内に設けられた陰極から放出され た電子を電子通過孔を有する陽極との間で加速して、前 記の真空領域の外部に取り出す為の電子透過窓を含む構 造体を円筒状に形成し、この電子透過窓を含む構造体に は周方向に肉厚が大きい第1の部分と肉厚が小さい第2 の部分を交互に設け、この第2の部分は真空隔壁を構成 しながら電子を透過させる電子透過窓としての働きを し、前記の第1の部分は機械的強度を保ちながら前記の 第2の部分を冷却する働きをもっており、前記の電子透 過窓を含む構造体を高速度で回転させることによって、 前記の第2の部分の温度上昇を小さくし、短時間に高密 度の電子線を透過させることができるようにしている。 また、前記の電子透過窓を含む構造体は、液体金属を潤 滑剤とする動圧滑り軸受に連結されており、これを介し て回転を許容した状態で強制冷却されているので全体と しての温度上昇は低く抑えられている。この電子透過窓 を含む構造体と繋がった円筒状の支持構体は磁性流体に よって真空容器との境界部分を真空シールされた状態で 前記の真空領域を構成しながら高速度に回転できるよう に支持されている。また、前記の動圧滑り軸受を介した 冷却機構が前記の電子透過窓と前記の真空シール部分と の伝熱通路の途中に設けられているので磁性流体が存在 する部分の温度が十分に低く保たれており、信頼性が確 保されている。

【〇〇〇7】前記の回転する円筒状の電子透過窓を含む 構造体の内側には真空容器に固定されたガイドが設けられており、被照射体と前記の電子透過窓を含む構造体と が接触しないように電子透過窓を含む構造体の最小の径 よりも小さな径内に被照射体を支えるようになってい る。又 前記の電子透過窓を含む構造体の回転中心軸に 向かって電子を照射するように放射状に複数個の陰極が 取り付けられている。これらの陰極は、断面が細長い長 方形である電子線を発生し、その長手方向が前記の電子 透過窓を含む構造体の回転中心軸にほぼ並行状態になる ように取り付けられている。この電子線が電子透過窓を 透過する際に散乱されるので、電子透過窓を含む構造体 の内側では周方向に均一化された強度分布を持つ電子線 を取り出すことができる。

【0008】前記の電子透過窓を含む構造体は回転しており、こ電子透過窓を含む構造体の肉厚が大きい第1の部分で電子の進行が阻止されるので透過した電子線の強度は時間的には正弦波的に変化するが、この間の被照射体の移動により空間的にはほば均一化された電子線が照射される。照射目的によっては、時間的にも空間的にも極めて均一な線量分布を持つことが必要な場合もあるが、この場合にはこの円筒状の電子透過窓を含む構造体の回転と同期させて前記の隆極を同軸状に回転させるこ

とによって達成される。真空空間において陰極を回転しながら電子を照射する方法は例えば特許出願番号「特願2000-100157」、「特願2000-100158」公報等に記述している。本発明は、これらの場合をも包含している。

【0009】前記の真空容器は、真空ポンプによって常時排気されており、前記の磁性流体によって回転自在に真空シールされており、真空シールの部分からの真空リークが無視できるほど小さく、常に高真空状態が維持できるようになっている。そのために、微小放電などの不具合が発生せず、高信頼度の状態を維持することができる。また、構造が簡単であるために小型で低価格の全周照射型の電子線照射装置を提供することができるようになった。

[0010]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図2は本発明の一実施形態である回転ウインドウ型電子線照射装置の縦断面図であり、図3は図2のAA」における横断面図、図4は図3の中央部分の拡大図、図5は本発明の主要部である電子透過窓を含む構造体の一構成要素部分を示す斜視図、図6は本発明の主要部である電子透過窓を含む構造体の他の構成要素部分を示す斜視図である。図7と図8は他の実施形態の回転ウインドウ型電子線照射装置の概略縦断面図である。同じ部分は同じ番号を付与している。簡略化の為に断面のハッチングは部分的に省略している。図9と図10は本発明の特性を説明する図面である。

【0011】図2及び図3及び図4において、真空容器 100は、高電圧供給用の絶縁体10-1、10-2、 10-3、10-4、10-5、10-6と、回転シー ル機構200を構成する外側スリーブ201と、回転シ ール機構200を構成する内側スリーブ202と、回転 シール機構200を構成するシール機構部203と、後 述する電子照射窓機構4とによって囲まれた真空空間を 形成している。真空容器100には図示しない真空ポン プが接続され、上記の真空空間は常時10-6~10 - 8 Torr程度の真空度に保たれている。電子照射窓 機構4はロータ301に接続されており、ロータ301 の外側にはステータ302が取り付けられており、これ らは誘導モータ300を形成しており、動作時には10 Orps程度の高速度で電子照射窓機構4を回転させる ようになっている。このように高速で電子照射窓機構4 が回転した場合でも前記のシール機構部203を介して 高真空状態が保たれるようになっている。

【0012】前記の回転シール機構200のシール機構部203は、固定部分と回転部分の微小なギャップに磁性流体を磁力で付着させて内部を高真空状態に保てるようになっている。磁性流体は80℃以下に保つ必要があり、回転シール機構200用外側スリーブ201から導入した水で固定部分は強制水冷されている。回転シール

機構200用内側スリーブ202も同様に温度上昇が許されないので、回転シール機構200用内側スリーブ202に接続されている電子照射窓機構4は、液体金属を潤滑剤とする動圧滑り軸受401、402を含む冷却機構400-1、400-2によって強制冷却されている。この動圧滑り軸受401、402は、回転する回転体と回転しない固定体とを含んでおり、これらが数十ミクロンのギャップを有して対向する軸受面の少なくとも一方にヘリンボーン状の軸受溝を有しており、このギャップの中にガリウムの合金から成る常温で液体の金属が充填されており、この液体金属を通じて回転体と固定体の間で大きな熱伝導が行われる。

【0013】前記の動圧滑り軸受401、402の固定体は、真空容器100の壁からフレキシブルな通路410、411を通して真空を保った状態で導入された水を通路403、404に流すことによって強制水冷される。前記の動圧滑り軸受401、402の固定体は、回転は禁止されているが半径方向及び回転軸方向には移動可能であるように可動部材405、406によって保持されている。この機構により、軸受ギャップが一定に保たれて電子照射窓機構4はスムーズな回転を保証されると共に、前記の液体金属を介して良好に冷却される。

【0014】電子銃は放射状に6個が取り付けてある が、同様の構造になっているのでその内の1つの電子銃 E1について説明する。高電圧供給用の絶縁体10-1 の先端に電子銃支持体12-1が取り付けられており、 電子銃支持体12-1の先端には集束電極1-1が取り 付けられている。集束電極1-1の先端部には直方体形 状に切り取られた窪みが在り、その中にタングステン合 金で出来たコイル状の陰極2-1が前記の窪みの中に電 気絶縁を保って取り付けられている。集束電極1-1と コイル状の陰極2-1は電子銃E1を構成している。コ イル状の陰極2-1の両端はリード線ペア11-1のそ れぞれに接続されており、リード線ペア11-1のそれ ぞれの他端は真空を保った状態で高電圧供給用の絶縁体 10-1の先端部分で図示しない高電圧電源に接続され る。コイル状の陰極2-1はその長手方向が中心軸C C'にほぼ平行になるように取り付けられている。

【0015】前記の電子銃E1の先端と対向する位置に電子通過孔5-1を有する陽極3が取り付けられており、接地電位に固定されている。集東電極1-1及び陰極2-1には前記の高電圧電源から500KV以下の負の高電圧が供給される。この電圧の値は被照射体の処理の種類によって変更される。前記の陰極2-1の両端にはおよそ15Vの電圧が印加され、陰極2-1は2130℃程度に加熱されて熱電子を放出し、この熱電子は、集東電極1-1によって細長い長方形の断面を持つ電子線Bに集束されながら陽極との電位差で加速されて電子通過孔5-1を通過する。

【0016】電子照射窓機構4は、図2に示すように、

回転支持する為の支持部分4-1と、冷却のための動圧 滑り軸受部分4-2、4-3と電子を透過させる為の電 子透過部分4-4とを含んでおり、電子透過部分4-4 は、図3と図4に示すように、周方向にスリットが並ん だ第1の構造体4-4aとこの第1の構造体4-4aに 貼り付けられた金属箔4-4bと、周方向にスリットが 並んだ第2の構造体4-4cとを含んでおり、これらは 気密に取り付けられている。前記の第1の構造体4-4 aは図5に、第2の構造体4-4cは図6に斜視図で示 してある。第1の構造体4-4aの表面に前記の金属箔 4-4 bを気密に貼りつけたものを第2の構造体4-4 cの中心の穴4-4dの中に密着挿入される。この際、 それぞれのスリット5-1aと5-1b、5-2aと5 -2b、5-3aと5-3b、5-4aと5-4b、5 -5aと5-5b、5-6aと5-6bとがそれぞれ一 致するように例えば電子ビーム溶接などで気密に取り付 けられて、電子透過部4-4を構成する。この電子透過 部4-4は、厚さが15μm程度以下のチタニュームか ら出来た電子透過窓4-4bと熱伝導率が大きい肉厚の 構造体で出来た熱伝導機構部4-4 e とが周方向に交互 に配列された構造になっている。 電子透過窓4-4 b は 前記の金属箔で出来ているのでこれと同じ番号を付して いる。この電子透過部4-4の両端に前記の軸受部分4 -2、4-3、及び支持部分4-1が気密に取り付けら

【0017】電子照射窓機構4は、図2に示すように、 支持部分4-1に取り付けられた軸受204によって回 転自在に支承されおり、誘導モータ300によって10 Orps程度の高速度で回転される。図4に示すよう に、前記の陽極3の電子通過孔5-1を通過してきた断 面が細長い長方形の電子線Bは、電子透過部4-4の電 子透過窓4-4 b が対面する瞬間にこれを透過して被照 射体6に入射する。この際、一部の電子が電子透過窓4 **-4bに吸収されてこの部分が加熱される。その直後に** 電子透過窓4-4 bは回転移動しており、電子線 B は熱 **伝導機構部4−4eの外側面7−1に衝突して吸収され** る。この部分は、熱容量が大きいのと熱伝導が大きいの で電子線Bによって加熱されても温度上昇が抑制されて 比較的低い温度に保たれる。熱伝導機構部4-4 e は動 圧滑り軸受部分4-2,4-3と熱的に連結されてお り、これら部分で強制冷却されているので、熱伝導機構 部4-4 e は等価的に大きな熱容量を持つことになり、 その温度は低く保たれる。熱伝導機構部4-4eに接合 されている電子透過窓4-4bは急激に冷却されるので 温度上昇が低く保たれる。電子照射窓機構4の回転速度 が大きくなるほど電子透過窓4-4bの温度上昇の抑制 効果が高くなって、高密度の電子を透過させることがで きる。このようにして、電子照射窓機構4を高速度で回 転させることによって信頼性良く電子透過窓4-4bを 透過させることができる電子の密度が増大させられる。

【0018】被照射体ガイド502、503の構造と動作について説明する。被照射体ガイド502、503は、電子照射窓機構4の内径よりも小さな内径を有する筒状の形状であり、端部が真空容器100に固定されている。電子照射窓機構4が高速度で回転しているにもかかわらず、これが被照射体に接触しないようになっている。電子透過部4-4においては、被照射体ガイド502、503は電子透過部4-4を避けるように分割されており、電子が衝突しないようになっている。電子照射窓機構4は高速度で回転しており、前記の電子透過窓4-4bの内径側は1気圧程度の不活性ガスが流れており、この分の回転で不活性ガスが吹き当てられて電子透過窓4-4bが強制冷却される。

【0019】被照射体6の処理の仕方について述べる。被照射体6の全体を端部から照射する場合には前記のコイル状の陰極2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6に通電した状態で電子照射窓機構4を回転させながら被照射体ガイド502,503の内側端部から被照射体6を挿入する。被照射体6を均一に照射する場合には、電子線強度を一定にして被照射体6を一定速度で移動させるか、被照射体6の移動速度に合わせてコイル状の陰極2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6の温度を自動的に制御する。

[0020]

【実施例】次に本発明の回転ウインドウ型電子線照射装 置の作用について実施例を用いて説明する。前記の電子 照射窓機構4を回転させないで電子透過窓4-4bに断 面が細長い長方形の電子線Bを入射した場合には、これ らの電子透過窓4-4bが薄くて熱伝導が小さいので電 子透過窓4-4b内における温度差が大きくなる。 前記 の熱伝導機構部4-4 e に接する部分と前記の電子透過 窓4-4bの中央部との温度差は大きくなり、電子透過 窓4-4 b内での熱応力が大きくなる。例えば、電子透 過窓4-4bの内径が6mm、鉄で出来た熱伝導機構部 4-4eの外径が30mm、それぞれの電子透過窓4ー 4 bの幅が1. 5mm、長さが2 0 mmの状態でそれぞ れの電子透過窓4-46に162Wの電子線を入射した 場合、およそ81Wがそれぞれの電子透過窓4-4bを 透過して被照射体6に照射され、残りのおよそ81Wが それぞれの電子透過窓4-4bで吸収され、前記の電子 透過窓4-4b内における温度差は186度に達する。 【0021】これは、鉄で出来た前記の熱伝導機構部4 -4eにより前記の電子透過窓4-4bが冷却されてい るので低い値に保たれている結果である。仮に、熱伝導 機構部4-4 e を無くして筒状の電子透過窓4-4 bの みで構成されている場合にははるかに大きな温度上昇が 発生することは明らかである。このように、中心軸に平 行な方向に細長い電子透過窓4-4bをこれに平行な細 長い熱伝導機構部4-4eで挟むことによって電子透過 窓4-4bを冷却すると共に、電子透過窓4-4bが真 空領域と大気圧領域の圧力差に耐えるようになっている。

【0022】しかしながら、更に前記の電子透過窓4-4 b 内での温度分布の差を小さくすることが、電子透過 窓4-4bの信頼性を増す上で好ましい。前記の電子透 過窓4-4b内での温度分布の差を小さくすることは、 前記の構造の電子照射窓機構4を高速度で回転させるこ とによって達成される。この様子を図9に示している。 図9は電子照射窓機構4の回転速度と電子透過窓4-4 b内での温度分布の差との関係の例を示している。図9 からわかるように、前記の電子照射窓機構4を1 r p s の速度で回転させた場合には前記の電子透過窓4-4 b 内での温度差は161度に減少し、回転速度を10rp sまで上昇させると前記の電子透過窓4-4b内での温 度差は136度まで減少し、回転速度を100rpsま で上昇させると前記の電子透過窓4-4 b内での温度差 は96度まで減少している。 更に 回転速度が無限大で ある場合には前記の温度差は92度となる。従って、前 記の電子照射窓機構4を100rps程度まで高速回転 させれば十分であることがわかる。上記の結果は、単位 時間内に前記の被照射体6に照射される線量が同じにな る条件で比較されている。上記の数値例は電子照射窓機 構4の構造寸法や材質によって異なった値になるが、上 述の傾向はどの場合にも不偏的に成り立つ。

【0023】上記の様に、電子透過窓4-4bに入射する電子線Bを時間的に変化させないで被照射体6に同一の照射線量を与える場合に、電子照射窓機構4を回転させた場合には電子線Bは電子透過窓4-4bと熱伝導機構部4-4eの両方に入射されて、電子照射窓機構4を固定して電子透過窓4-4bのみに電子線を入射した場合よりも前記の電子透過窓4-4b内での温度差は小さくなる。図10には、電子透過窓4-4b内での温度差は小さくなる。図10には、電子透過窓4-4bの中央部と熱伝導機構部4-4eの温度の時間的な変化の例を示している。図10の(4)は無限大の速度で回転している場合の熱伝導機構部4-4eの温度であり、(1)は電子照射窓機構4の回転速度が1rpsの場合における、

(2)は電子照射窓機構4の回転速度が10rpsの場合における、(3)は電子照射窓機構4の回転速度が無限大の場合における、電子透過窓4-4bの中央部でのそれぞれの温度変化の例を示している。回転速度が大きいほど電子透過窓4-4bの温度の最高値は低くなっている。

【 O O 2 4】電子照射窓機構4の回転角度を検出して、 これに同期させて電子透過窓4-4 bに入射する電子線 Bの強度を時間的に変化させることによって電子線Bを 電子透過窓4-4 bのみに入射するように制御すれば更 なる低温化の効果が得られる。

【0025】上記の実施形態及び実施例では、被照射体 6の周方向における照射線量の分布は、前記の電子透過 窓4-4bでの電子の散乱により均一化される。特に、被照射体6が細い形状である場合にはより均一になる。 被照射体が太い形状である場合には前記の陰極と電子透過窓4-4bとを回転中心軸CC,に対して周方向に4 5度以下の範囲で傾斜させておくとより均一な線量分布を得ることができる。被照射体6に照射される線量は、前記の熱伝導機構部4-4eで妨げられるタイミングがあるので時間的に変化するが、前記の電子照射窓機構4の回転速度が十分に速い場合には被照射体6を移動させることにより平均化されるので大部分の電子線照射処理において問題とならない。

【0026】被照射体6が微弱なX線に対しても悪影響を受易い物質であった場合には、発生するX線を極力減少させるために、熱伝導機構部4-4eの表面に鉄よりも原子番号が小さい物質から成る部材を取り付けておくと良い。また、電子透過窓4-4bを透過した電子線Bを出来るだけ多く被照射体6に入射させるためには、電子透過窓4-4bをできる限り被照射体6に近づけることが好ましい。従って、電子透過窓4-4bの直径は熱伝導機構部4-4eの内径とほぼ等しくなるように構成されている。

【0027】次に、変形された実施形態について図7を 用いて説明する。図7の実施形態では、回転シール機構 200を真空容器100の両側に設けることにより、回 転する電子照射窓機構4の内径部分を貫通させて細長い 被照射体6の電子線照射処理に適した構造に変形した例 を示している。他の部分は図2 図3、図4に示した実 施形態と同様であるので細部の説明は省略する。更に、 他の変形された実施形態について図8を用いて説明す る。図8の実施形態は、電子照射窓機構4の回転中心軸 の方向に電子透過部4-4を複数個設けることにより、 被照射体6の周囲により多くの陰極を配列して細長い形 状の被照射体6の周方向の線量分布をより均一にした場 合を示している。隣接する電子透過部4-4の間には、 液体金属潤滑材を用いた動圧滑り軸受407と冷却水通 路408と可動部材409から成る冷却機構が設けられ ており、これで強制冷却されている。

【0028】本発明を実施形態及び実施例に関連して説明したが、本発明は、ここに例示した実施形態及び実施例の構造及び形態に限定されるものではなく、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、いろいろな実施形態が可能であり、いろいろな変更及び改変を加えることができることを理解されたい。例えば、電子透過窓4ー4bの内側を真空にした状態で被照射体6に電子線を照射できることは勿論である。また、陰極の数は限定されるものではなく、1個でも10個以上でもよい。

【発明の効果】以上説明したように本発明の電子線照射 装置を採用すると、立体的な構造を有する被照射体を回 転させること無く全周方向から電子線を高密度で照射で きる。電子透過窓の温度上昇が減少するので大線量率の 電子線を得ることが出来、照射処理の速度を高めること ができる。特に、被照射体が小さい場合や細長い場合に は電子密度が高いのでこの効果が大きい. 反対に、同一 の線量率を得るためには電子透過窓の温度を低くするこ とができるので電子透過窓の信頼性を高めることができ る。また、多くの陰極を用いることにより被照射体の周 方向の線量分布が均一化される。特に、陰極と電子透過 窓とを同期して回転させると完全に均一にできる。更 に、装置全体がコンパクトであり、低価格となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の電子線照射装置の概略横断面図である。

【図2】本発明の一実施形態である回転ウインドウ型電 子線照射装置の縦断面図である。

【図3】本発明の縦断面図である図2のAA'における 横断面図である。

【図4】本発明の主要部である図3の中央部を拡大した 図である。

【図5】本発明の主要部である電子透過窓を含む構造体 の一構成要素部分を示す斜視図である。

【図6】本発明の主要部である電子透過窓を含む構造体 の他の構成要素部分を示す斜視図である。

【図7】他の実施形態に係わる回転ウインドウ型電子線 照射装置の縦断面図である。

【図8】他の実施形態に係わる回転ウインドウ型電子線 照射装置の縦断面図である。

【図9】本発明の特性を説明するグラフである。

【図10】本発明の特性を説明するグラフである。

【符号の説明】

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6集束電極

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6コイル状の陰極

3 陽極

電子照射窓機構 4

電子照射窓機構支持部分 4 - 1

4 - 2動圧滑り軸受部分

4 - 3動圧滑り軸受部分

電子透過部分 4 - 4

電子透過部分の第1の構造体 4 - 4a

電子透過部分の金属箔 4 - 4 b

電子透過部分の第2の構造体 4 - 4 c

取付け穴 4 - 4 d

熱伝導機構部 4 - 4 e

5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6 電子通過孔

被照射体

高電圧供給用の絶縁体 $10-1. \sim 10-6$

11-1, \sim , 11-6リード線

12-1, ~, 12-6 電子銃支持体

真空容器 100

回転シール機構 200

回転シール機構用外側スリーブ 201

回転シール機構用内側スリーブ 202

磁性流体から成るシール機構部 203

300 誘導モータ

誘導モータのロータ 301

誘導モータのステータ 302

動圧滑り軸受からなる冷 400-1,400-2

却機構

6

動圧滑り軸受 401

動圧滑り軸受 402

冷却水の通路 403

冷却水の通路 404

405 可動部材

可動部材 406

動圧滑り軸受 407

冷却水の通路 408

冷却水の通路 410

冷却水の通路 411

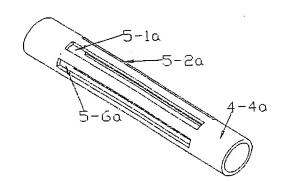
被照射体ガイド 502 被照射体ガイド

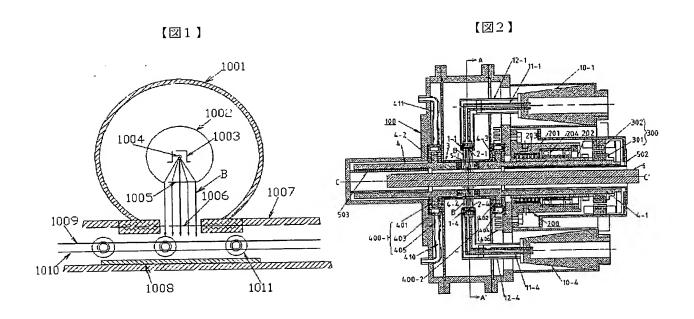
503 🗧

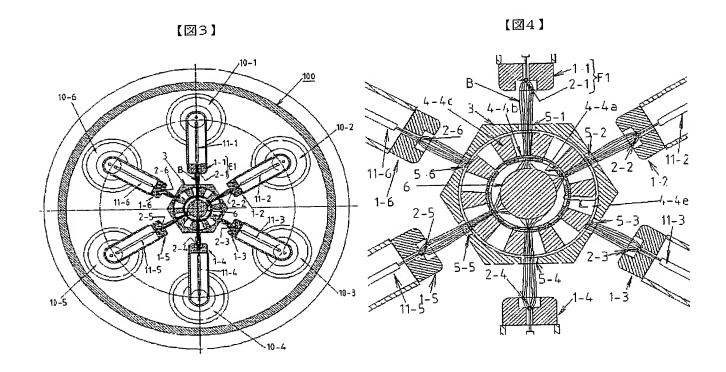
電子線 В

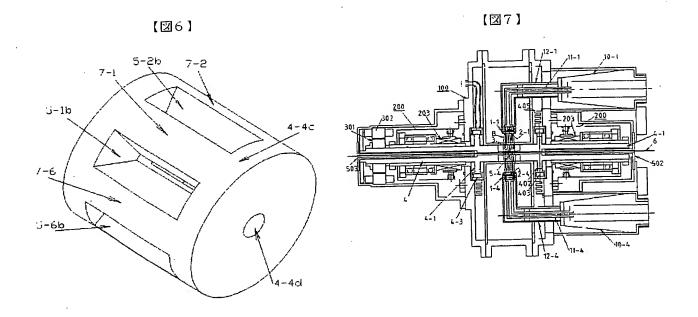
電子銃 E 1

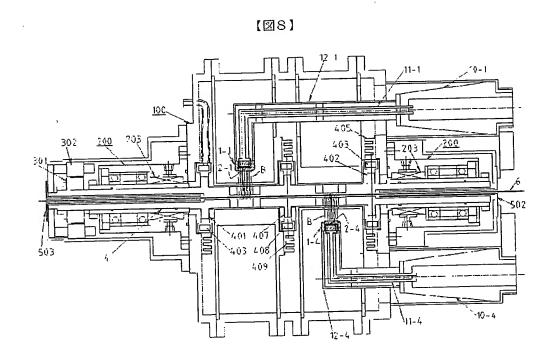
【図5】



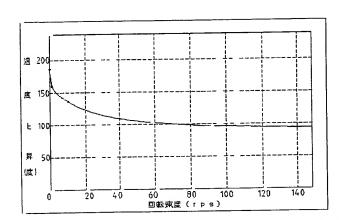




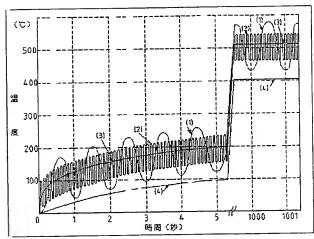








【図10】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 G 2 1 K 5/04 識別記号

FI G21K 5/04 (参考)

Ε